### 発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

出願人代理人 五十嵐 荷	
様	
	PCT
〒 220-0011	国際調査機関の見解書
神奈川県横浜市西区髙島2丁目10番13号 横浜 東ロビル908号室	(法施行規則第40条の2) [PCT規則43の2.1]
来自こ200万里 	(1 O 1 MEM 150 72. 1)
	<sup>発送日</sup> (日. 月. 年) 01. 3. 2005
	(日.月.年) 1.3.2005
出願人又は代理人	今後の手続きについては、下記2を参照すること。
の啓類記号 PCTMP1200	
国際出願番号 国際出願日	· 優先日
PCT/JP2004/017788 (日.月.年) 30.	11.2004 (日.月.年) 02.12.2003
国際特許分類 (IPC)	
Int. Cl' H01Q 13/08、H01	IQ 5/01 H01Q 9/42
出願人(氏名又は名称)   株式会社 村田製作所	
WATE THATFU	
1 との日知事はあの内容も合す。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1. この見解書は次の内容を含む。 	
第1個 優先権	
第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能	<b>能性についての見解の不作成</b>
第Ⅳ欄 発明の単一性の欠如	
X 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、
それを裏付けるための文献及び説明	
第VI欄 ある種の引用文献	
第 VII 欄 国際出願の不備	
X 第四欄 国際出願に対する意見	
2. 今後の手続き	
	査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国
	国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさ
ない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見 	解語は国際予備番食機関の最初の見解語とみなされる。
この見解告が上記のように国際予備審査機関の見解むとみ	なされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日か
	期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当
な場合は補正費とともに、答弁費を提出することができる	0
さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照す	ること。
3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参	照すること。
見解傷を作成した日	
15.02.2005	
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 5 T 3 2 4 5
日本国特許庁 (ISA/JP)	西山 昇
郵便番号100-8915	電話番号 03-3581-1101 内線 3526
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3526

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2004年1月)

第1欄 見解の基礎	
1. この見解書は、下	下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。
この見解登は、それは国際調	、 語による翻訳文を基礎として作成した。 査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。
2. この国際出願で開 以下に基づき見解	用示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 解告を作成した。
a . タイプ	配列表
	<b>配列表に関連するテーブル</b>
b. フォーマット	· 查面
	コンピュータ読み取り可能な形式
c. 提出時期	出願時の国際出願に含まれる
	この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された
	出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された
	刊表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出し 質時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が
4. 補足意見:	
	·
	·
	*
	·
	,

		E3 61	10-4 JEL 17	X (X) *	- 7011	- 60										7												
第Vi	¶ 新規性、i それを要	_				川用豆	能	生に <b>-</b>	つい	ての	D P	C.	T 規	則	430	<b>&gt;2</b> .	1 (a)	(i) ł	こ定る	める	見角	¥、 ——						
1.	見解																											
ž	· 新規性(N)				1	請求 請求	の範 の範	.囲 .囲					1	<u>- 8</u>	3													有無
j	進歩性(IS)	)			1	請求語求	の範 の範	. 田 _					1	<u> </u>	3						,						; ;	有無
į	・ 産業上の利用 <sup>・</sup>	可能性	: (I A	A)		請求 請求	の範 の範	i囲 _ i囲 _					1	<u> </u>	3						<u> </u>						<sup>2</sup>	有無
2.	文献及び説	——— 明											-															
	·文献1 08.1 548	: J 0、	全文																									
	・文献 2 1.10	_																	製化	乍列	<del>ī</del> )	2	0	0	3.	).	О	
	・文献3 2.09																											1
	·文献4 S, LL 834	C)	2 0																									
	・文献 5 公開 2 ー ィルム ( なし)	8 1	2号	<del>-</del> ) (	の願	書	これ	系付	し	た	明	細	書	及	び	図	面の	内	容る	を言	己鉧	とし	た	7	イ:	ク	口 ,	フ

篮VIII 概	国際出所に対する音目	1

請求の範囲、明細沓及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細費による十分な裏付についての意見を次に示す。

・請求の範囲1には、オープンスタブを形成する位置が明確に記載されていない。請求の範囲に係る発明は、そもそも<u>放射電極の高次波の最大電流分布領域にオープンス</u>タブを形成する点を特定しなければ、本願発明の作用効果を奏するとは認められない。

様式PCT/ISA/237 (第四個) (2004年1月)

#### 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

#### 第 V 欄の続き

・請求の範囲1-4, 6-8に係る発明は、文献1-5により進歩性を有しない。 文献 1 (特に、段落【0037】【0040】【0055】【0073】一【0075】【0085】一【0087】、第1-4, 8, 12, 13図)には、3倍波又は基本波の電流が最大となる放射電極上の領域に、直列的にインピーダンス成分を付加するか、或いは、並列的に容量成分を付加することによって、基本モードの共振周波数と高次モードの共振周波数を独立に制御する技術が記載されている。

文献1の上記技術を文献2の放射電極にも採用することは当業者にとって容易にな し得る事項である。

また、放射電極に延長部(オープンスタブ)設けて面積を拡大し、容量成分を付加する技術は、例えば文献 3-5等に記載されているように周知であり、上記並列的に容量成分を付加する場合に放射電極に延長部(オープンスタブ)設けて容量成分を付加することに、格別の困難性は認められない。

・請求の範囲5に係る発明は、文献1-5により進歩性を有しない。 文献2の段落【0032】等にも記載されているように、2放射電極の形成方向に 角度を付けて結合容量を調整する技術は周知である。

### PATENT COOPERATION TREATY

From	the .	Japan Patent Off	ice (INTERNATIO	ONAL SEARCHING	G AUTH	HORITY)						
To:	Age	nt for Applicant					PCT					
	_	Kiyoshi IGARA					101					
Ad	dress	-										
			guchi Building #90		WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY							
	Takashima 2-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0011, Japan					(Impler	menting Regulation 40					
	Kanagawa 220-0011, Japan					(PCT Rule 43bis. I)						
						ate of mailing						
		,			(da	ay/month/year)	01. 3. 2005					
<del>.                                    </del>	<del></del>				-							
Ap	•	nt's or agent's file	e reference		FC	OR FURTHER AC						
<del>  _</del>		FMP1200	3.7		1117		ee paragraph 2 below					
Inte		ional application		International filing	; date (a	!ay/montn/year)	Priority date (day/mo	nth/yea.	<i>r)</i>			
<u></u>		F/JP2004/017788		30. 11. 2004			02. 12. 2003					
Inte	ernati	ional Patent Clas	, ,	20 11010 5/01 H01/	~ 0/42							
<u> </u>	-1:00		int.Cl. Hully 13/0	08, H01Q 5/01, H01C	Q 9/42							
Αþ	plica	nt rata Manufacturi:	ina Co. Ltd						:			
	Wiui	ala Manuracturi	ng Co., Liu.									
1.	Thi	s opinion contair	ns indications rela	ting to the following	items:							
<b>.</b> .	<b>E</b>	Box No. I	Basis of the opir	-	, 1.01							
		Box No. II	Priority Priority	non								
		Box No. III		ent of oninion with re	regard to	o novelty inventive	step and industrial ap	nlicabil	itv			
		Box No. IV	Lack of unity of	•	Ugui C	J hovery, m. a	. Step and modernia	phodo	11.5			
	×	Box No. V			ie l(a)(i	i) with regard to no	velty, inventive step or	r industr	rial			
	_		applicability; cit	tations and explanation				HIGUSA	iai			
		Box No. VI	Certain documer									
		Box No. VII	Certain defects i	in the international ar	pplicati	on						
	×	Box No. VIII	Certain observat	tions on the internation	ional ap	plication						
2.	FU	RTHER ACTIO	N				·					
							onsidered to be a writ					
							ply where the applicar ternational Bureau und					
				nal Searching Author				301 1	00.10.2(5)			
							the applicant is invite ation of 3 months from					
							y date, whichever exp					
	For	further options,	see Form PCT/ISA	A/220			•		-			
3.	For	further details, s	see notes to Form	PCT/ISA/220								
L						•						
Dai	e or	completion of th	is opinion	15. 02. 2005								
Na	me aı	nd mailing addre	ess of the ISA/JP			Authorized officer		5T	3245			
		Jar	pan Patent Of	ifice		Noboru NISH	IYAMA	!	<del></del>			
3-4	3-4-3. Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915. Japan Telephone No. 03-3581-1101 Fxt 3526											

10/581803 TRECTIFIED UT JUN 2005

## WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No. PCT/JP2004/017788

Box	ιN	lo.	I Basis of this opinion
1.			regard to the language, this opinion has been established on the basis of the international application in the language in h it was filed, unless otherwise indicated under this item.
			This opinion has been established on the basis of a translation from the original language into the following language, which is the language of a translation furnished for the purpose of international search (under Rules 12.3 and 23.1(b)).
2.			regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application and necessary to the ned invention, this opinion has been established on the basis of:
a.	1	typ	e of material
	ı		a sequence listing
	1		table(s) related to the sequence listing
b.		for	mat of material
	ſ		in written format
	í		in computer readable form
c.	1	tim	ne of filing/furnishing
	{		contained in the international application as filed.
	(		filed together with the international application in computer readable form.
	ĺ		furnished subsequently to this Authority for the purposes of search.
3.			In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
4.	A	ddi	tional comments:

## WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No. PCT/JP2004/017788

Box	No. V Reasoned statement applicability; citation	under Rule 43 <i>bis</i> .1(a)(i) was and explanations suppo	ith regard to novelty, inventive rting such statement	step or industrial
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-8	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims		YES
		Claims	1-8	NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-8	YES
		Claims		NO
2. (	Citations and explanations:			
	Document 1: JP 2001-217643 A2 & US 6452548 B2	A (Murata Manufacturing C	Co., Ltd.) 2001.08.10, full text, ful	ll drawings & EP 1122812
	· Document 2: JP 2003-8326 A (	Murata Manufacturing Co.	, Ltd.) 2003.01.10, full text, full c	Irawings & US 6657593 I
	· Document 3: WO 2002/75853 2003/160728 A1	A1 (Matsushita Electric In	dustrial Co., Ltd.) 2002.09.26, Pa	ge 10, Fig. 15 & US
	Document 4: WO 2003/7429 A	AI (HRL LABORATORIES	S, LLC) 2003.01.23, Page 6, Fig. 3	2 & US 2003/52834 A1
	Model Registration Application	No. 63-77911 (Japanese U	n and drawings attached to applic nexamined Utility Model Registra orporation) 1990.01.05, Page 6, F	ation Application
	•			•
	•			
	•			

# WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No. PCT/JP2004/017788

Box No. VIII	Certain observations on the international application
The following ob supported the des	oservations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully scription, are made:
construe	I does not clearly describe the position where an open stub is formed. The invention defined in claims is not ed as achieving an operation and an advantage of the invention of this application unless a point in which the ub is formed in a higher-order wave maximum current distribution region of a radiation electrode is specified.
	ļ
	•
	<b>!</b>
	·
	•
	·

### WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No. PCT/JP2004/017788

#### Supplemental Box

In case the space in any of the preceding boxes is not sufficient.

Continuation of Box No. V:

· The invention according to Claims 1 to 4 and Claims 6 to 8 lack an inventive step over Documents 1 to 5.

Document 1 (in particular, paragraphs [0037], [0040], [0055], [0073]-[0075], and [0085]-[0087] and Figs. 1-4, 8, 12, and 13) describes a technology for individually controlling a resonant frequency of a fundamental mode and a resonant frequency of a higher-order mode by providing impedance components in series or providing capacitance components in parallel to a region on a radiation electrode in which a third-harmonic-wave or fundamental-wave current is maximum.

Adopting the above-mentioned technology described in Document 1 to a radiation electrode of Document 2 is easily conceivable by those skilled in the art.

In addition, a technology for providing an extension portion (open stub) to a radiation electrode in order to increase an area to provide a capacitance component is well known, for example, as described in Documents 3 to 5. Providing capacitance components in parallel by providing an extension portion (open stub) to a radiation electrode is not construed as being exceptionally difficult.

· The invention according to Claim 5 lacks an inventive step over Documents 1 to 5.

As described in paragraph [0032] of Document 2, a technology for forming an angle in the forming direction of two radiation electrodes in order to adjust coupling capacitance is well known.

Form PCT/ISA/237 (Supplemental Box) (January 2004)